

Оценка надежности функционирования метрологической линии на полупроводниковом производстве

Домашнее задание

Власов Е.Ю.

8 мая 2018 г.

Содержание

1	Вве	едение	1
2	Контроль 1		1
	2.1	Схема перевода метрологической линии из работоспособно-	
		го состояния в неработоспособное	3
	2.2	Прямой порядок восстановления	3
	2.3	Обратный порядок восстановления	4
	2.4	Вывод	5
3	Контроль 2		5
	3.1	Основное соединение	7

1 Введение

Как известно, соблюдение норм метрологического контроля необходимо для производства качественной продукции в любой отрасли промышленности. Чем меньше допуск - тем больше должна быть разрешающая способность и точность метрологического обороудования.

В качестве примера предлагается рассмотрению линия метрологического контроля полупроводникового производства MAPPER LLC: контроль после проведения процесса термического оксидирования, а также процедура проведения контроля качества процесса контактной литографии (см. рис. 1).

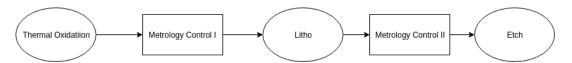


Рис. 1: Структура и этапы проведения контроля

2 Контроль 1

Процедура метрологического контроля состоит в проверке равномерности нанесенного оксида кремния на поверхность кремниевой подложки. Данное измерение может быть проведено с помощью двух взаимозаменяемых приборов, которые на схеме ниже (см. рис. 2) условно обозначены как Filmetrics и Ellipsometer. (смысл и назначение ясно из названий, вид приборов приведен на рис. 4 и рис. 3).

Metrologi Control I

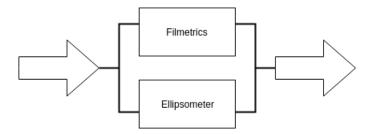


Рис. 2: Структурная схема 1 контроля



Рис. 3: Эллипсометер



Рис. 4: Прибор для измерения толщины пластин и покрытий (filmetrics)

На основе данных о количестве ремонтов оборудования за год и переводов в статус высокого загрязнения (что также будем относить к неработоспособному состоянию) вычислим параметры интенсивности

отказов и восстановления, затем на основе построенных графов, описывающих дублированную систему, вычислим коэффициент готовности при прямом порядке восстановления и обратном.

2.1 Схема перевода метрологической линии из работоспособного состояния в неработоспособное

Будем рассматривать ординарный поток, значит прямого перехода из работоспособного состояния в неработоспособное у данной системы нет.(см. рис. 5).

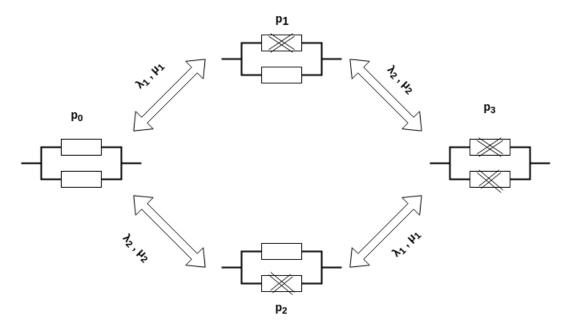


Рис. 5: Граф

2.2 Прямой порядок восстановления

При прямом порядке восстановление начинают с элемента, отказавшего первым. Наглядно это может быть представлено как на рис. 6.

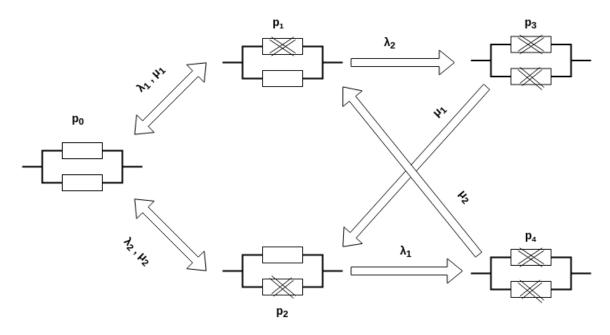


Рис. 6: Прямой порядок восстановления

2.3 Обратный порядок восстановления

Прим обратном порядке - первым восстановлению подлежит элемент, отказавшим последним. Схема на рис.

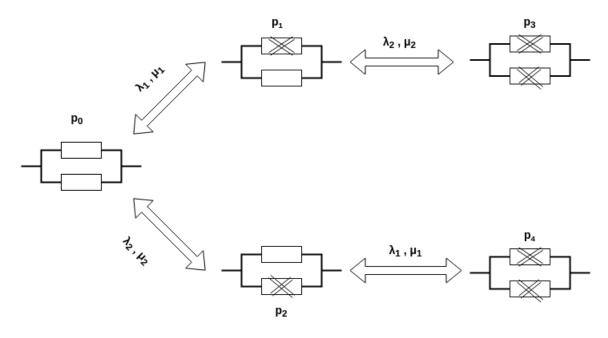


Рис. 7: Обратный порядок восстановления

2.4 Вывод

Исходя из сложности обслуживания оборудования и квалификации ремонтных бригад можно оценить коэффициент готовности метрологической систем. Результаты расчета приведены в приложении к отчету. Стоит заметить, что при восстановлении системы, где первый элемент восстановить сложнее, но отказывает он реже, более предпочтительным является обратный порядок восстановления, что подтверждается расчетом в приложении. Подбирая более квалифицированные и опытные бригады можно добиться достаточно высокого значения коэффициента готовности оборудования.

3 Контроль 2

Процедура контроля качества процесса литографии выглядит как показано на рис. 8. Оборудование показано на рис. и рис.

Metrology Control II (In-line procedure)



Рис. 8: Структурная схема 2 контроля



Рис. 9: Интерферометр для измерения эллиптичности и изгиба пластин



Рис. 10: Оптический микроскоп

3.1 Основное соединение

Представим данный процесс в виде основного соединения и рассмотрим, как влияет интенсивность отказов первой установки, второй и сложности их восстановления на коэффициент готовности.

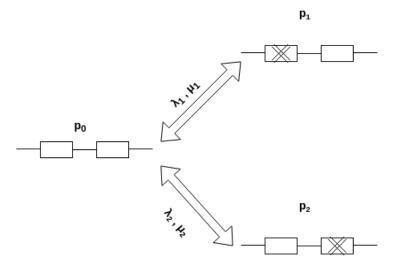


Рис. 11: Граф

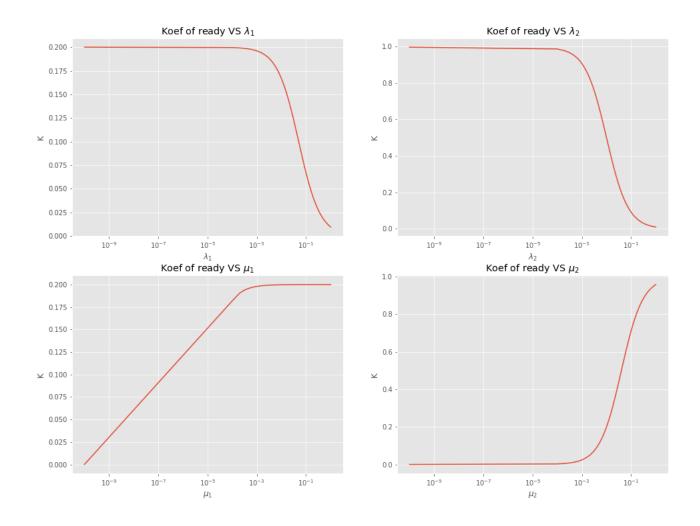


Рис. 12: Влияние интенсивности отказов и восстановлений на коэффициент готовности системы

```
clear all;
clc;
mu1 = 0.5*10^{(-2)};
mu2 = 2.5*10^{(-4)};
lambda1 = 50*10^{(-6)};
lambda2 = 35*10^{(-3)};
p2 = mu2*mu1*(lambda1+lambda2+mu1)*lambda2/
(lambda1^2*lambda2*mu1+lambda1^2*lambda2*mu2+lambda1^2*mu1+mu2+lambda1*lambda2^2*mu1+lambda2^2*mu2+lambda1^2*mu1+lambda1^2*mu2+lambda1
p1 = mu1*(lambda1*mu2+lambda2*mu2+mu2^2)*lambda1/
(lambda1^2*lambda2*mu1+lambda1^2*lambda2*mu2+lambda1^2*mu1+mu2+lambda1*lambda2^2*mu1+lambda2^2*mu2+lambda1^2*mu1+lambda1^2*mu2+lambda1
p0 = mu1*mu2*(lambda1*mu1+lambda2*mu2+mu1*mu2)/
(lambda1^2*lambda2*mu1+lambda1^2*lambda2*mu2+lambda1^2*mu1*mu2+lambda1*lambda2^2*mu1
Kg = p2+p1+p0;
fprintf('direct recovery order: %f\n',Kg);
p0_back = 1/ (1+lambda1/mu1 + lambda2/mu2 + 2*lambda1*lambda2/
(mu1*mu2));
p1_back = lambda1/mu1*p0_back;
p2_back = lambda2/mu2*p0_back;
Kg_back = p0_back +p1_back + p2_back;
fprintf('reverse recovery order: %f\n', Kg_back);
direct recovery order: 0.828473
reverse recovery order: 0.980530
```

Published with MATLAB® R2016a

$$A := Matrix \left(\left[\left[-(\lambda I + \lambda 2), \frac{\mu I^2}{\lambda 2}, \frac{\mu 2^2}{\lambda I} \right], \left[\lambda I, -\frac{\mu I \cdot (\lambda 2 + \mu I)}{\lambda 2}, \mu 2 \right], \left[1, 1 + \frac{\mu I}{\lambda 2}, 1 + \frac{\mu 2}{\lambda I} \right] \right)$$

$$A := \begin{bmatrix} -\lambda I - \lambda 2 & \frac{\mu I^2}{\lambda 2} & \frac{\mu 2^2}{\lambda I} \\ \lambda I & -\frac{\mu I (\lambda 2 + \mu I)}{\lambda 2} & \mu 2 \\ 1 & 1 + \frac{\mu I}{\lambda 2} & 1 + \frac{\mu 2}{\lambda I} \end{bmatrix}$$

$$(1)$$

> *Det*(*A*)

$$Det \begin{bmatrix} -\lambda I - \lambda 2 & \frac{\mu I^2}{\lambda 2} & \frac{\mu 2^2}{\lambda I} \\ \lambda I & -\frac{\mu I (\lambda 2 + \mu I)}{\lambda 2} & \mu 2 \\ 1 & 1 + \frac{\mu I}{\lambda 2} & 1 + \frac{\mu 2}{\lambda I} \end{bmatrix}$$
 (2)

> det(A)

$$det \begin{bmatrix} -\lambda I - \lambda 2 & \frac{\mu I^2}{\lambda 2} & \frac{\mu 2^2}{\lambda I} \\ \lambda I & -\frac{\mu I (\lambda 2 + \mu I)}{\lambda 2} & \mu 2 \\ 1 & 1 + \frac{\mu I}{\lambda 2} & 1 + \frac{\mu 2}{\lambda I} \end{bmatrix}$$
(3)

> simplify(%)

$$det \begin{bmatrix} -\lambda I - \lambda 2 & \frac{\mu I^2}{\lambda 2} & \frac{\mu 2^2}{\lambda I} \\ \lambda I & -\frac{\mu I (\lambda 2 + \mu I)}{\lambda 2} & \mu 2 \\ 1 & \frac{\lambda 2 + \mu I}{\lambda 2} & \frac{\lambda I + \mu 2}{\lambda I} \end{bmatrix}$$

$$(4)$$

 \rightarrow DET_BASE := linalg[det](A);

$$DET_BASE := \frac{1}{\lambda 2 \lambda I} \left(\lambda I^{2} \lambda 2 \mu I + \lambda I^{2} \lambda 2 \mu 2 + \lambda I^{2} \mu I \mu 2 + \lambda I \lambda 2^{2} \mu I + \lambda I \lambda 2^{2} \mu 2 + \lambda I \lambda 2 \mu I^{2} \right)$$

$$+ 2 \lambda I \lambda 2 \mu I \mu 2 + \lambda I \lambda 2 \mu 2^{2} + \lambda I \mu I^{2} \mu 2 + \lambda I \mu I \mu 2^{2} + \lambda 2^{2} \mu I \mu 2 + \lambda 2 \mu I^{2} \mu 2$$

$$+ \lambda 2 \mu I \mu 2^{2} + \mu^{2} \mu^{2} \right)$$

$$> A_I := Matrix \left(\left[\left[0, \frac{\mu I^{2}}{\lambda 2}, \frac{\mu 2}{\lambda I} \right], \left[0, -\frac{\mu I \cdot (\lambda 2 + \mu I)}{\lambda 2}, \mu 2 \right], \left[1, 1 + \frac{\mu I}{\lambda 2}, 1 + \frac{\mu 2}{\lambda I} \right] \right] \right)$$

$$A_I := \begin{bmatrix} 0 & \frac{\mu I^{2}}{\lambda 2} & \frac{\mu 2^{2}}{\lambda I} \\ 0 & -\frac{\mu I (\lambda 2 + \mu I)}{\lambda 2} & \mu 2 \\ 1 & 1 + \frac{\mu I}{\lambda 2} & 1 + \frac{\mu 2}{\lambda I} \end{bmatrix}$$

$$P0 := (\mu I \mu_{2} (\lambda I \mu I + \lambda 2 \mu 2 + \mu I \mu_{2})) / (\lambda I^{2} \lambda 2 \mu I + \lambda I^{2} \lambda 2 \mu 2 + \lambda I^{2} \mu I \mu 2 + \lambda I \lambda 2^{2} \mu I$$

$$+ \lambda I \lambda 2^{2} \mu 2 + \lambda I \lambda 2 \mu I^{2} + 2 \lambda I \lambda 2 \mu I \mu 2 + \lambda I \lambda 2 \mu 2^{2} + \lambda I \mu I^{2} \mu 2 + \lambda I \mu I \mu 2^{2}$$

$$+ \lambda 2^{2} \mu I \mu 2 + \lambda 2 \mu I^{2} \mu 2 + \lambda 2 \mu I \mu 2^{2} + \mu^{2} \mu 2^{2} \right)$$

$$> A_3 := Matrix \left(\left[\left[-(\lambda I + \lambda 2), 0, \frac{\mu 2^{2}}{\lambda I} \right], \left[\lambda I, 0, \mu 2 \right], \left[1, 1, 1 + \frac{\mu 2}{\lambda I} \right] \right] \right)$$

$$A_3 := \begin{bmatrix} \lambda I - \lambda 2 & 0 & \frac{\mu 2^{2}}{\lambda I} \\ \lambda I & 0 & \mu 2 \\ 1 & 1 & 1 & \frac{\mu 2}{\lambda I} \end{bmatrix}$$
(5)

>
$$P3 := \frac{linalg[det](A_3)}{DET_BASE}$$

$$P3 := \left(\left(\lambda I \, \mu 2 + \lambda 2 \, \mu 2 + \mu 2^2 \right) \, \lambda 2 \, \lambda I \right) / \left(\lambda I^2 \, \lambda 2 \, \mu I + \lambda I^2 \, \lambda 2 \, \mu 2 + \lambda I^2 \, \mu I \, \mu 2 + \lambda I \, \lambda 2^2 \, \mu I \right)$$

$$+ \lambda I \, \lambda 2^2 \, \mu 2 + \lambda I \, \lambda 2 \, \mu I^2 + 2 \, \lambda I \, \lambda 2 \, \mu I \, \mu 2 + \lambda I \, \lambda 2 \, \mu 2^2 + \lambda I \, \mu I^2 \, \mu 2 + \lambda I \, \mu I \, \mu 2^2$$

$$+ \lambda 2^2 \, \mu I \, \mu 2 + \lambda 2 \, \mu I^2 \, \mu 2 + \lambda 2 \, \mu I \, \mu 2^2 + \mu I^2 \, \mu 2^2 \right)$$

$$(9)$$

>
$$P1 := \frac{\mu I}{\lambda 2} \cdot P3$$

 $P1 := (\mu I (\lambda I \mu 2 + \lambda 2 \mu 2 + \mu 2^2) \lambda I) / (\lambda I^2 \lambda 2 \mu I + \lambda I^2 \lambda 2 \mu 2 + \lambda I^2 \mu I \mu 2 + \lambda I \lambda 2^2 \mu I + \lambda I \lambda 2^2 \mu 2 + \lambda I \lambda 2 \mu I^2 + 2 \lambda I \lambda 2 \mu I \mu 2 + \lambda I \lambda 2 \mu 2^2 + \lambda I \mu I^2 \mu 2 + \lambda I \mu I \mu 2^2$
(10)